

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl.⁷
H05H 1/00

(11)
(43)

10-2004-0005161
2004 01 16

(21) 10-2002-0039468
(22) 2002 07 08

(71)

5-27 2

(72)

973-3 804 302

204-1203

401-1204

(74)

:

(54)

me) 가 {poly, oxide, metal etcher, CVD(Chemical Vapor Deposition) } (do
가 가 , 가 (chamber)
, (dome), (coil) (a) 가
(b) n:1 가 , 가 .
(가)

2

1a (plasma) ,

1b 1a ,

2 (dome) ,

3a 3b

< >

a : (center,)

b : 가 (edge,)

c :

or Deposition) } , {poly, oxide, metal etcher, CVD(Chemical Vap (dome) 가 가

1a

(wafer)가 가 가 1:1 가 (chamber); () (dome); (coil) 가 (inductive supply) 가

() 9.3 9.8 (Al₂O₃) , 3 ()

(masking) (radical) 가 (gas) (ion) 가 (plasma) 가 (edge,) 가 (center,) 가

1b

가 가 가 가 ,

가 가 가 가

ze) 가 , (c) 가 (wafer) (si) 가

r), (dome), (coil) 가 (chambe
 가 (b)가 n:1 가 (a)
 , n 1<n 5

e) 가 (c) (wafer) (siz
 가 12inch(300mm) 가 8inch(200mm) c 100mm 300mm
 300mm 500mm c 200mm 400mm 가 16inch(400mm) c

2 (dome)
 (a) 가 (b) 1a
 a:b가 1:1 가 a:b가 n:1 1<n 5
 (dome) (c) 가 8inch(200mm) c 가 100mm 300mm , 12inch(300mm) c 가 2
 00mm 400mm , 16inch(400mm) c 가 300mm 500mm

3a 3b
 3a 3b (a) 가 (b) 가 2:1 3:1 , 1b
 가 가 가 가
 가

가) 가 (

(57)
 1. 가 (chamber), (dome),
 (coil) {poly, oxide, metal etcher, CVD(Chemical Vapor Deposition)
 }

가 (b)가 n:1 가 (a)

2.

1 ,
n 1 < n 5

3.

1 2 ,

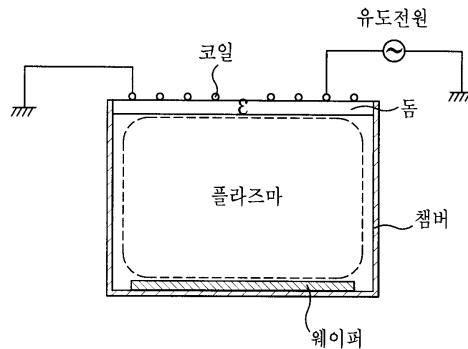
(c) , (wafer) (size) 가

4.

3 ,

가 8inch(200mm) c 100mm 300mm , 가 12inch
(300mm) c 200mm 400mm , 가 16inch(400mm) c
300mm 500mm

1a



1b

